BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL « TRAITEMENTS DES MATÉRIAUX » SESSION 2025

Épreuve E2 :

Étude et préparation d'une production industrielle

Durée : 4 h Coefficient : 4

SUJET

Aucun document autorisé.

L'usage de calculatrice avec mode examen actif est autorisé.

L'usage de calculatrice sans mémoire, « type collège » est autorisé.

Ce sujet est composé de deux parties :

Partie 1 : SUJET

• Mise en situation : de la page 2/18 à la page 5/18

• Ressources : de la page 6/18 à la page 18/18

Partie 2 : DOSSIER RÉPONSE

• Dossier réponse : de la page 1/13 à la page 13/13

• Barème : page 2/13

Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu'il est complet.

- Vous devrez répondre directement sur le dossier réponse dans les espaces prévus, en apportant un soin particulier à la rédaction des réponses aux différentes questions.
- Vous ne devrez pas noter vos nom et prénom sur ce dossier hormis sur le dossier réponse dans la partie anonymée en haut de la première page.
- Vous devrez rendre l'ensemble des documents du dossier réponse en fin d'épreuve.

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TRAITEMENTS DES MATÉR	IAUX 25-BCP-TDM-U2-ME1	Session 2025	Sujet
ÉPREUVE E2 : Étude et préparation d'une production industrie	le Durée : 4 heures	Coefficient : 4	Page 1/18

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL « TRAITEMENTS DES MATÉRIAUX » SESSION 2025

Épreuve E2:

Étude et préparation d'une production industrielle

PARTIE 1

SUJET

Décoration sur ABS : métallisation des plastiques

Notes à l'attention du candidat :

- Ce dossier ne sera pas à rendre à l'issue de l'épreuve.
- Aucune réponse ne devra figurer sur ce dossier.

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TRAITEMENTS DES MATÉRIAUX	25-BCP-TDM-U2-ME1	Session 2025	Sujet
ÉPREUVE E2 : Étude et préparation d'une production industrielle	Durée : 4 heures	Coefficient : 4	Page 2/18

1. Mise en situation:

La société Graindorge, basée à Sens, est leader du marché français et européen dans le traitement de surfaces de pièces métalliques et plastiques pour l'industrie cosmétique de luxe.



Leur expertise technique dans le domaine du traitement électrochimique sur plastiques leur permet d'être à la pointe du secteur et de proposer à leurs prestigieux clients des produits finis fiables bénéficiant du label « Made in France ».

Bien que traitant également des substrats en laiton et zamak, l'activité principale de l'entreprise se tourne essentiellement vers les plastiques moulés et injectés de type ABS (Acrylonitrile – Butadiène – Styrène). Tout l'enjeu de ce secteur d'activité est de permettre la métallisation par voie électrochimique d'une matière non-conductrice.

Le procédé de traitement se divise en deux étapes distinctes : la **métallisation** à proprement parler de l'ABS d'une part, et les **différents traitements électrolytiques** servant au renforcement et à l'embellissement des pièces d'autre part.

La métallisation de l'ABS :

La métallisation de matériaux non-conducteurs par voie électrochimique est rendue possible par l'ajout préalable d'un revêtement conducteur d'électricité, obtenu par voie chimique. La plus grande difficulté de mise en œuvre de cette technique n'est pas la mise en place du dépôt métallique. Son adhérence et sa résistance dans le temps face aux contraintes subies par les pièces (changements de températures, humidité, efforts, ...) sont complexes à obtenir.



Pièce ABS brut



Pièce traitée finition « canon de fusil »

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TRAITEMENTS DES MATÉRIAUX	25-BCP-TDM-U2-ME1	Session 2025	Sujet
ÉPREUVE E2 : Étude et préparation d'une production industrielle	Durée : 4 heures	Coefficient : 4	Page 3/18

Le procédé de métallisation consiste à créer des aspérités à la surface du substrat par extraction du butadiène présent dans le mélange ABS grâce à l'action de l'acide chromique H₂ Cr O₄. Cette étape, extrêmement polluante pour l'environnement et l'humain car contenant des chromes VI (Cr^{VI}), sera à l'avenir remplacée par une attaque au permanganate de potassium, moins polluant, mais également moins stable en solution.

La formation de ces aspérités va permettre l'accroche du nickel chimique par ensemencement de la surface au palladium, métal noble. Cette couche de nickel chimique d'un minimum de 2 µm d'épaisseur va rendre la surface de la pièce conductrice et permettre les traitements électrolytiques suivants. La gamme de métallisation est présentée dans le document ressource N°1 page 6/18.

Traitements multicouches

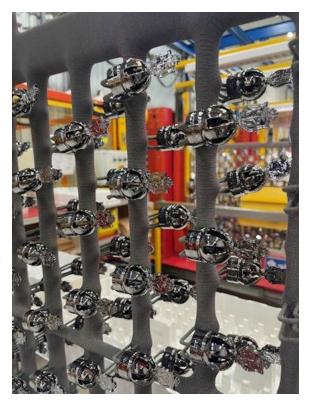
Une fois la couche conductrice en place, le procédé de traitement répondant au cahier des charges client, peut commencer. Les différents traitements se font par voie électrolytique. Il s'agit d'effectuer pour commencer un cuivrage acide de charge d'une épaisseur de 10,5 µm suivi d'une activation acide puis d'un dépôt de 5 µm de nickel de Watt brillant. Enfin, dans le but de fournir la finition attendue pour cette série de pièces, les bouchons subissent un revêtement de nickel noir couleur « canon de fusil » de 1 µm

d'épaisseur. Sur cette ligne, la cuve de traitement du cuivrage acide est présente en 5 exemplaires amovibles. De même, la finition nickel noir possède 2 cuves de traitement identique.

Tous les bains de traitement sont suivis d'un rinçage mort et d'un rinçage cascade. Le bain de finition est, quant à lui, précédé et suivi d'un rinçage éco, en lieu et place d'un rinçage mort habituel.

Les pièces partent ensuite à l'étuve pour séchage (10 min) puis sont déchargées des montages.

Les différents bains présents sur cette ligne de traitement et dans l'atelier sont définis dans le document ressource N°2 page 7/18.



Montage des bouchons sur support industriel

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TRAITEMENTS DES MATÉRIAUX	25-BCP-TDM-U2-ME1	Session 2025	Sujet
ÉPREUVE E2 : Étude et préparation d'une production industrielle	Durée : 4 heures	Coefficient : 4	Page 4/18

Contrôle qualité des pièces

Avant expédition, les bouchons sont contrôlés visuellement d'une part pour vérifier les défauts extérieurs et l'homogénéité de la coloration, et par coupe métallographique d'autre part, pour contrôler les épaisseurs de dépôts. Le prélèvement des pièces à tester se fait de façon aléatoire tout au long du montage. Les métallographies résultant des prises d'essai sont données dans le **document ressource N°3 page 8/18**.

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TRAITEMENTS DES MATÉRIAUX	25-BCP-TDM-U2-ME1	Session 2025	Sujet
ÉPREUVE E2 : Étude et préparation d'une production industrielle	Durée : 4 heures	Coefficient : 4	Page 5/18

Documents Ressources

> Document ressource N° 1 : Gamme de métallisation

	N°	Opération	Rôle	Composition	T (°C)	ép. (μm)	ddc A.dm ⁻²	V _d (μm.h ⁻¹)	t (min)
	1	Dégraissage	Action dégraissante et augmente la mouillabilité de la pièce.	Solution PM900	60				5
	2	Rinçage cascade			Amb.				1
	3	Satinage	Satinage sulfochromique. L'anhydride chromique CrO ₃ détruit les particules de butadiène créant les aspérités.	CrO ₃ : 350 g.L ⁻¹ H ₂ SO ₄ : 450 g.L ⁻¹	65				7
	4	Rinçage mort			50				0,5
	5	Rinçage cascade			Amb.				1
JE JE	6	Réduction	Élimine le Cr ^{vi} par réduction.	Solution d'acide glyoxylique	35				4
MIQL	7	Rinçage cascade			Amb.				1
GAMME CHIMIQUE	8	Activation	Système colloïdal de chlorure d'étain et de palladium. Ce système est adsorbé sur les aspérités de surface de l'ABS.	PdCl ₂ : 0,25 g.L ⁻¹ SnCl2: 15 g.L ⁻¹ HCl: 60 mL.L ⁻¹	40				6
	9	Rinçage cascade			Amb.				1
	10	Accélération	Élimination du colloïde protecteur du palladium le rendant ainsi actif pour le nickel chimique.	Solution PM964					4
	11	Rinçage cascade			Amb.				1
	12	Nickel chimique	Rend la pièce conductrice pour la gamme électrolytique.	Ni _{métal} : 6 g.L ⁻¹ H ₂ PO ²⁻ :30 g.L ⁻¹	31	2		15	8
	13	Rinçage mort			Amb				0,5
	14	Rinçage cascade			Amb.				1
CTRO	15								
GAMME ELECTRO	16								
GAM									

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TRAITEMENTS DES MATÉRIAUX	25-BCP-TDM-U2-ME1	Session 2025	Sujet
ÉPREUVE E2 : Étude et préparation d'une production industrielle	Durée : 4 heures	Coefficient : 4	Page 6/18

> Document ressource N° 2 : Bains de l'atelier

Bains de préparation :

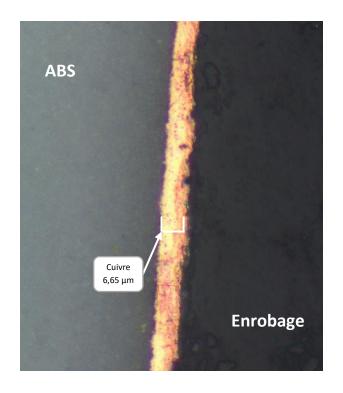
- Dégraissage chimique
- Dégraissage électrolytique anodique
- Dégraissage électrolytique cathodique
- Polissage électrolytique
- Activation à 10% de HCI
- Activation à 1% de HCI
- Satinage
- Blanchiment
- Décapage sulfochromique
- Décapage chimique à 50% de HCI
- Décapage chimique à 50% de HNO₃
- Décapage électrolytique anodique

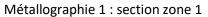
Bains de traitement :

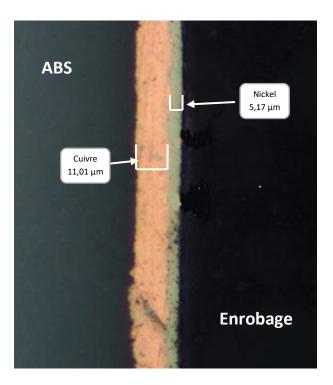
- Cuivrage alcalin cyanuré
- Cuivrage acide
- Nickelage de Watt
- Nickelage de Wood
- Oxydation anodique sulfurique
- Chromage trivalent
- Chromatation hexavalente

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TRAITEMENTS DES MATÉRIAUX	25-BCP-TDM-U2-ME1	Session 2025	Sujet
ÉPREUVE E2 : Étude et préparation d'une production industrielle	Durée : 4 heures	Coefficient : 4	Page 7/18

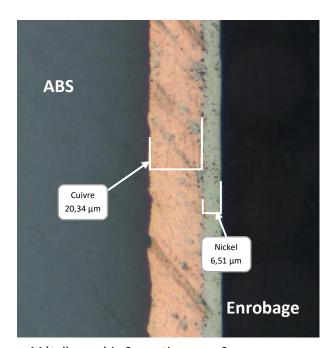
> Document ressource N° 3 : Métallographies de contrôle



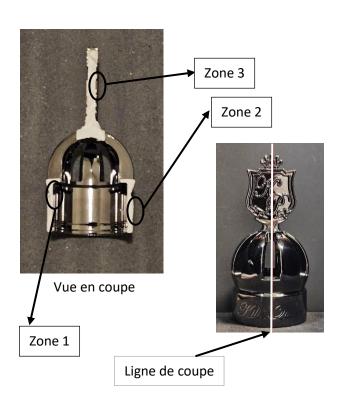




Métallographie 2 : section zone 2



Métallographie 3 : section zone 3



BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TRAITEMENTS DES MATÉRIAUX	25-BCP-TDM-U2-ME1	Session 2025	Sujet
ÉPREUVE E2 : Étude et préparation d'une production industrielle	Durée : 4 heures	Coefficient : 4	Page 8/18

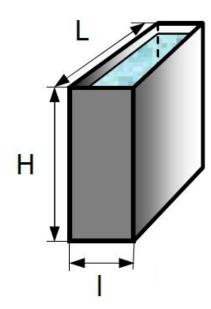
> Document ressource N° 4 : tableau périodique des éléments

Illa IVa Va Via Via Vila VIII Ib IIIb IIVb		Masse volumique (g.cm-3) ► 8.9 28 ► Numéro atomique	Ni Symbole chimique	Nom de l'élément	Masse atomique g.mol-1	AI Si	9	4,51 226,1 237,19 247,43 257,86 268,9 278,9 288,96 297,14 305,91 31	Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge	Scandium Titene Venadum Chrome Mangamies Fer Cobalt Nickel Cuivre Znc Gaillum 1,1 45,0 47,9 50,9 52,0 54,9 55,9 58,9 58,7 63,5 65,4 69,7	1,5 43 12,2 44 12,4 45 12 46 10,5 47 8,65 48 7,31 49 7,3 50 6	Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In	.0 88,9 91,2 92,9 95,9 99,0 101,1 102,9 106,4	6.17 57 13,1 72 16,6 73 19,3 74 21 75 22,6 76 22,5 77 21,4 78 19,3 79 13,6 80 11,85 81 11,4	La Hf Ta W Re Os Ir	Lanthane Hahrium Tantale Tungsteine Phérium Osmium Inidium Pitatire Or 138.9 178.5 181,0 183,9 188,2 190,2 192,2 195,1 197,0	89 104	a Ac Ku	0	0,122
a	1	31,85	.i Be	Lithium Béryllium 6,9	11 1,74	Na Mg	Sodium Magnésium 23,0 24	191,55	Sa	Potassium Caldium 39,1 4(37 2,6	Rb Sr	Rubidium Strontium 85,5 87	3,5	Cs Ba	Césium Baryum 132.9 137		Fr	13.0 Rad	

	5,67 58	*65 77 59 * 60 *	. 60		, 62	5,25 63	7,89 64	8,27 65	62 5,25 63 7,89 64 8,27 65 8,54 66 8,8	8,8 67	67 9,05 68	86,969 86,98	6,98 70	9,84 71
Lanthanoides	Se	ቯ	욷	Pm	Sm	Eu	m Sm Eu Gd Tb	Тb	ρ	윈	Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb	٦	Υp	ב
	Cérium	Praséodyme	Néodyme	Prométhéum	Samarium	Europium	Gadolinium	Terbium	Dysprosium	Holmium	Erbium	Thulium	Ytterbium	Lutécium
	140,1	140	14	145,0	150,4	152,0	157,3	158,9	162,5	164,9	167,3	168,9	173,0	175,0
)6 *	0,		* 93	. 94	. 95	96 .	. 97	*	· ·	100	101	* 102	* 103
Actinoides	ц Ч	Th Pa	\supset	8 N	Pu	Am	S	BK	ŭ	Es	Fm	βg	ž	×
	Thorium	Protactinium	Uranium	Neptunium	Plutonium	Américium	Curium	Berkélium	Californium	Einsteinium	Fermium	Mendélévium	Nobélium	Lawrencium
	232,0	231,0	53	237,0	242,0	243,0	243,0	249,0	249,0	254,0	255,0	256,0	254,0	257,0

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TRAITEMENTS DES MATÉRIAUX	25-BCP-TDM-U2-ME1	Session 2025	Sujet
ÉPREUVE E2 : Étude et préparation d'une production industrielle	Durée : 4 heures	Coefficient : 4	Page 9/18

> Document ressource N° 5 : Moyen de production



Longueur de la cuve L = 2 000 mm

Hauteur de la cuve H = 1 140 mm

Largeur de la cuve I = 900 mm

Les cuves sont agitées par insufflation d'air lorsque cela est nécessaire et chauffées par serpentin en fond.

Le niveau des bains se situe à 100 mm du bord supérieur des cuves.

L'intensité maximale admise par les différents redresseurs de cette ligne ABS est :

cuivrage acide : 1 000 ANickel de Watt : 1 000 ANickel noir Déco : 2 000 A

Informations sur les bains électrolytiques :

Type de bain	Composition	Teneur	°C	R _c %	ddc A.dm ⁻²	ion
Cuivrage acide	Voir fiche technique (docu	ument ressour	ce n° 6)	2,2	Cu ²⁺
	Sulfate de nickel NiSO ₄ ,7H ₂ O	330				
	Chlorure de nickel NiCl ₂ ,6H ₂ O	65				
Nickel de Watt	Acide borique H ₃ BO ₃	50	58	95	2,5	Ni2+
	Filtration continue					
	Sulfate de nickel NiSO ₄ ,7H ₂ O					
Nickel noir	Chlorure de nickel NiCl ₂ ,6H ₂ O	1 48 1 97 1 35		Ni2+		
1 TOKOT TION	Bis(sulfamidate) de nickel			14121		
	Ni(SO ₃ NH ₂) ₂ ,4H ₂ O					

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TRAITEMENTS DES MATÉRIAUX	25-BCP-TDM-U2-ME1	Session 2025	Sujet
ÉPREUVE E2 : Étude et préparation d'une production industrielle	Durée : 4 heures	Coefficient : 4	Page 10/18

> Document ressource N° 6 : Fiche technique du cuivrage acide (extrait)



Cuivre acide

NOTICE TECHNIQUE

Doc.-No.: 02-2513-08 SAP-N°: 1678623

IMDS-No.: 736943

Version: 11

Cupracid PL

Bain de cuivre acide brillant

CONTENU

1. Information procédé	2
2. Equipement	2
3. Pré-Traitement	
Montage	4
5. Paramètres de travail	5
6. Entretien	
Effet des additifs	
Compatibilité de mélange des additifs	
Comportement des additifs	
7., Recommandations d'application	
Additifs anti piqure	
Cupracid 530 Correction	
Cupracid anti mousse	9
Cupracid Promoteur	
Cupracid Additive UN	
8. SAP No. pour entretien et montage	
9. Recommandations pour le traitement des eaux	
10. Instructions analytiques	
Détermination du cuivre par titrage	
Détermination de l'acide sulfurique par titrage	
Détermination du chlorure par titrage	
Détermination du chlorure par turbidimétrie	
Détermination du Cupracid Promoteur par titration	21

Page: 1 / 22

Date: Signature:

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TRAITEMENTS DES MATÉRIAUX	25-BCP-TDM-U2-ME1	Session 2025	Sujet
ÉPREUVE E2 : Étude et préparation d'une production industrielle	Durée : 4 heures	Coefficient : 4	Page 11/18



Cupracid PL Version: 11

Bain de cuivre acide brillant Doc.-No.: 02-2513-08

1. Information procédé

- Cupracid PL est une solution de cuivrage acide brillant à base d'acide sulfurique qui propose un dépôt sans tension, ductile et nivelant de cuivre particulièrement pour les substrats plastiques activés chimiquement.
- Cupracid PL a été spécialement développé pour l'application sur matières plastiques, mais il peut aussi être utilisé pour des métaux quand une nivelance plus faible est acceptable.
- Cupracid PL est connu pour son entretien simple.

2. Equipement

Cuve Acier doux recouvert de caoutchouc dur, PVC/Polyester-renforcé.

Aspiration Nécessaire

Chauffage / refroidissement Graphite, Titane, PTFE, PVC, Polyéthylène.

Agitation mécanique / électrolyte Agitation air nécessaire ; de plus une agitation cathodique est

avantageusement utilisée pour que toutes les pièces soient atteintes

par l'agitation air.

longueur du mouvement va et vient /min

 100 mm
 20 – 25

 60 mm
 25 – 30

 Agitation cathodique de préférence horizontale

Agitation air Le volume d'air nécessaire est d'environ

12 - 20 m³/h et par longueur de barre de cathode. Les tuyaux d'agitation air doivent être parallèles aux barres cathodiques environ 30 - 80 mm au dessus du fond de cuve. Selon la taille de la cuve, ils sont percés de trous d'un diamètre de 3 mm espacés par intervalles de 80 à 100 mm avec un angle de 45 ° du fond de cuve. Chaque tuyau possède deux rangées de trous espacées de 40 à 50 mm. Il est conseillé d'installer au moins deux tuyaux d'agitation air (diamètre intérieur 20 à 40 mm) dans le bain. La distance entre les tuyaux doit

être de 150 à 250 mm.

Les matériaux conseillés sont PVC ou polyéthylène.

	Page: 2 / 22	
Date:		Signature:

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TRAITEMENTS DES MATÉRIAUX	25-BCP-TDM-U2-ME1	Session 2025	Sujet
ÉPREUVE E2 : Étude et préparation d'une production industrielle	Durée : 4 heures	Coefficient : 4	Page 12/18



Bain de cuivre acide brillant Doc.-No.: 02-2513-08

Anodes

Anodes de cuivre spécial avec une teneur en phosphore de 0.03 à 0.06%, les anodes massives ou les anodes au phosphore dans des paniers en titane. Les anodes doivent être recouvertes de sacs en matériau résistant aux acides, matériau totalement synthétique. Pour éviter la passivation en cas d'utilisation d'anodes pleines, la peau de fonderie doit être éliminée avant utilisation (par ex. avec UniClean 697 et acide sulfurique).

Version: 11

3. Pré-Traitement

- Après le dépôt chimique, il est conseillé d'utiliser une dépassivation acide avant le traitement avec Cupracid PL.
- Après nickelage chimique il faut ajouter environ 10 ml/l de Cupracid PL Montage sera ajouté à une solution d'environ 10 % d'acide sulfurique.
- Après nickel chimique il faut ajouter environ 20 g/l Sulfate de cuivre(II) -5-Hydrate et 10 ml/l de Cupracid PL Montage sera ajouté à une solution d'environ 10 % d'acide sulfurique.
- La dépassivation est à 25 30 °C.
- Le temps de traitement est d'environ 2 5 minutes.

	Page: 3 / 22	
Date:		Signature:

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TRAITEMENTS DES MATÉRIAUX	25-BCP-TDM-U2-ME1	Session 2025	Sujet
ÉPREUVE E2 : Étude et préparation d'une production industrielle	Durée : 4 heures	Coefficient : 4	Page 13/18



Bain de cuivre acide brillant Doc.-No.: 02-2513-08

5. Paramètres de travail

Teneur en métal environ 55 g/l Cu

Densité du bain 1.17 g/cm³ à 20 °C

pH Inférieur à 1; ne nécessite pas de contrôle

Température du bain 20 à 30 °C, préférentiellement 24 à 28 °C.

Si la température atteint 30 °C, nous conseillons l'utilisation de Cupracid

Version: 11

HT.

Filtration Continue; Volume total du bain 2 - 3 x / 60 minutes. Pour atteindre un grand

niveau de filtration il est conseillé d'utiliser un adjuvant de filtration.

Adjuvant de filtration Terre de diatomées, cellulose

(on observe une faible augmentation de la consommation des additifs en

utilisant la terre de diatomées)

Tension 1.0 - 4.0 V; avec des cuves plus grandes jusqu'à 6 V, selon la densité de

courant et la charge du bain.

Densité de courant

Anode: 0.5 - 2.5 A/dm²

Pour la formation du film anodique la densité de courant anodique doit être supérieur à 0.5 A/dm². Pour éviter les passivations anodiques, la densité de

courant anodique ne doit pas excéder 2.5 A/dm².

Rendement Environ 100 %

Vitesse de dépôt 0.7 µm Cu/min. à 3 A/dm²

Les chiffres de la table ci-dessous ont été arrondis pour une minute pleine.

Densité de courant		Epaisseur de dépôt en μm				
	6 µm	9 μm	12 µm	24 µm	36 µm	48 µm
1,0 A/dm ²	28 min	41 min	54 min	108 min		101
2,0 A/dm ²	14 min	21 min	28 min	55 min	82 min	111 mir
3,0 A/dm ²	9 min	14 min	19 min	37 min	55 min	73 min
4,0 A/dm ²	7 min	11 min	14 min	28 min	42 min	55 min
5,0 A/dm ²	6 min	8 min	11 min	22 min	33 min	44 min
6,0 A/dm ²	5 min	7 min	9 min	18 min	27 min	35 min

Page: 5 / 22

Date: Signature:

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TRAITEMENTS DES MATÉRIAUX	25-BCP-TDM-U2-ME1	Session 2025	Sujet
ÉPREUVE E2 : Étude et préparation d'une production industrielle	Durée : 4 heures	Coefficient : 4	Page 14/18



Doc.-No.: 02-2513-08 Bain de cuivre acide brillant

6. Entretien

Paramètre	Au montage	Gamme opératoire
Cuivre	55 g/l	50 - 65 g/l
Acide sulfurique	65 g/l	50 - 70 g/l
lons chlorure	100 mg/l	80 - 120 mg/l

4.0 g/l de sulfate de cuivre (CuSO₄ • 5 H₂O) augmente la teneur en cuivre d'environ 1 g/l. Le sel est dissous dans de l'eau DI chaude (40 - 60 °C), et traité avec 10 mg de charbon actif par gramme de sulfate de cuivre (environ 1 heure).

0.57 ml/l d'acide sulfurique (densité 1.84 kg/l; environ. 95 % w/w) augmente la teneur en acide sulfurique d'environ 1 g/l. Pour éviter les surchauffes localisées ; l'acide sulfurique doit être ajouté lentement sous agitation.

16.7 mg/l de chlorure de sodium augmente la teneur en ions chlorure d'environ 10 mg/l. Avant ajout le chlorure de sodium est dissous dans une faible quantité d'eau DI.

Pour 10,000 Ah: 0.8 kg (0.4 - 1.2 kg) Cupracid PL Part A et

1.0 kg (0.7 - 1.2 kg) Cupracid PL Part B

La consommation dépend du degré de brillance et de nivelance exigé. Si des anodes pleines sont utilisées, la consommation de Cupracid PL Part B peut décroitre. Dans certains cas il est nécessaire d'ajouter 0.2 - 0.4 kg de

Version: 11

Cupracid PL Montage par 10,000 Ah.

Si le nombre d'ampère heure n'est pas connu, les quantités suivantes peuvent être ajoutées à 1000 l de bain quand le degré de brillance diminue:

0.1 - 0.2 | Cupracid PL Part A

0.2 - 0.4 | Cupracid PL Part B Les ajouts se font par gaps de 0.1 ml/l.

Pour compenser les pertes par entraînements, des ajouts de Cupracid PL pertes par entraînement. Montage sont nécessaires.

Les ajouts de sulfate de cuivre (II)-5-Hydrate indiquent les

Un ajout de 0.5 kg Cupracid PL Montage est conseillé pour un ajout de 10 kg Sulfate de cuivre (II)-5-Hydrate.

Si la teneur en cuivre dans la solution décroit sous la valeur standard pendant le solution traitée avec du charbon actif selon la travail il doit être compensé par ajout de sulfate de cuivre (II)-5-Hydrate.

Pour cela le sel est dissous dans de l'eau DI chaude et la procédure »montage », après filtration la solution peut être

ajoutée au bain.

٦	-	_			1 22
۲	а	a	e:	0	1 44

Date: Signature:

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TRAITEMENTS DES MATÉRIAUX	25-BCP-TDM-U2-ME1	Session 2025	Sujet
ÉPREUVE E2 : Étude et préparation d'une production industrielle	Durée : 4 heures	Coefficient : 4	Page 15/18



Bain de cuivre acide brillant Doc.-No.: 02-2513-08

Version: 11

Signature:

Effet des additifs

Pour atteindre une brillance et une nivelance optimum, Cupracid PL Part A et Cupracid PL Part B doivent être présents dans le bain dans une certaine proportion. Leur proportion mutuelle doit être strictement respectée, car les deux substances ont une action l'une sur l'autre. De ce fait un excès de l'une peut être compensé par un ajout de l'autre. Des fortes teneurs (supérieur à 1.2 kg/10,000 Ah) de Cupracid PL Part A favorise la formation de pores et doit de ce fait être évité.

Manque de Cupracid PL Montage

Date:

Un manque de Cupracid PL Montage peut conduire à des dépôts en relief dans les zpnes de fortes densités de courant, aux brulures et à la formation de pores. La teneur en Cupracid PL Montage actif évalué par CVS doit être supérieure à 5 ml/l dans un bain en fonctionnement.

Un manque de Cupracid PL Part A ou Excès de Cupracid PL Part B

Un manque de Cupracid PL Part A ou un excès de Cupracid PL Part B est reconnu par un faible effet de nivelance, par une augmentation de la pénétration de la brillance et des dépôts sporadiquement voilés dans les zones de moyennes et faibles densités de courant. Dans ce cas, ajouter du Cupracid PL Part A par gaps de 0.05 - 0.1 ml/l dans le bain.

Si de fréquentes additions de Cupracid PL Part A deviennent nécessaires, il faut faire des tests de concentration de Cupracid PL Part A et Cupracid PL Part B et si besoin les dosages de Cupracid PL Part B doivent être réduits ou augmenter les dosages de Cupracid PL Part A.

Un manque de Cupracid PL Part B ou un excès de Cupracid PL Part A

Un défaut de Cupracid PL Part B ou un excès de Cupracid PL Part A est identifié par des brûlures aux fortes densités de courant. Un excès important de Cupracid PL Part A peut provoquer des rugosités et des pores. Si ce défaut apparaît, Cupracid PL Part B doit être ajouté par pas de 0.1 ml/l. Pour éviter la formation de voile, Cupracid PL Part A doit aussi être ajouté simultanément (il doit être ajouté dans la proportion de 20% de la quantité de Cupracid PL Part B)

Cupracid PL Part A et Cupracid PL Part B doivent être ajoutés séparément dans le bain sous forte agitation.

Dans le cas de fortes brûlures, la concentration des constituants minéraux (Cu, H₂SO₄, Cl¹) doivent être contrôlés avant d'ajouter des additifs.

Compatibilité de mélange des additifs Cupracid PL Montage peut être mélangé au Cupracid PL Part B dans toutes les proportions. Cupracid PL Part A NE DOIT PAS être mélangé avec Cupracid PL Montage ou Cupracid PL Part B. Page: 7/22

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TRAITEMENTS DES MATÉRIAUX	25-BCP-TDM-U2-ME1	Session 2025	Sujet
ÉPREUVE E2 : Étude et préparation d'une production industrielle	Durée : 4 heures	Coefficient : 4	Page 16/18



Bain de cuivre acide brillant Doc.-No.: 02-2513-08

Version: 11

Comportement des additifs

Ce tableau indique la quantité d'additif détruit lors des traitements pratiqués.

Produit	5 g/l charbon actif	5 g/l charbon actif + 2 g/l KMnO ₄	1 ml/I H ₂ O ₂ 30 %	100 mg/l NaPS
Cupracid PL Part A	Complètement	Complètement	Presque complètement	Un peu
Cupracid PL Part B	Insignifiant	Complètement	Partiellement	Un peu
Cupracid PL Montage	partiellement	Complètement	Pas du tout	Pas du tout
Cupracid Mouillant Plus	Presque complètement	Complètement	Pas du tout	Pas du tout
Cupracid Super Wet 42	Presque complètement	Complètement	Pas du tout	Pas du tout

NaPS = persulfate de Sodium (Na₂S₂O₈)

7., Recommandations d'application

Pour maintenir la qualité de dépôt, il faut :

Analyser régulièrement les composants du bain pour éviter les fluctuations de concentrations. Pour la même raison, il est recommandé de faire régulièrement des cellules de Hull.

Si des paniers en titane et des sacs anodes sont utilisés il faut :

Les paniers anodiques doivent être nettoyés par dégraissage chaud pour éviter toute contamination du bain avec des huiles ou des copeaux métalliques.

Pour éliminer les produits de préparation les sacs doivent être nettoyés dans une solution chaude de carbonate de sodium (1.5%) et ensuite neutralisés dans une solution d'acide sulfurique (1%)

Les pertes par évaporation sont compensées par ajout d'eau déminéralisée.

	Page: 8 / 22	
Date:		Signature:

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TRAITEMENTS DES MATÉRIAUX	25-BCP-TDM-U2-ME1	Session 2025	Sujet
ÉPREUVE E2 : Étude et préparation d'une production industrielle	Durée : 4 heures	Coefficient : 4	Page 17/18

> Document ressource N° 7 : Gestion de production

$$T_{prod} = T_{avant} + n \times T_{long} + T_{finition}$$

T_{prod} : durée de production effective ;

Tavant : durée avant l'opération la plus longue ;

T_{long} : durée de l'opération de la gamme la plus longue ;

T_{finition}: durée restante après l'opération la plus longue ;

n= nombre de pièces ou de montages pouvant être traités.

> Document ressource N° 8 : Tolérance épaisseur

Le cahier des charges accepte une tolérance de :

- 10,5 \pm 1 μ m pour le cuivre acide
- $5 \pm 0.5 \mu m$ pour le nickel de Watt
- 1 \pm 0,2 μ m pour le nickel noir

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TRAITEMENTS DES MATÉRIAUX	25-BCP-TDM-U2-ME1	Session 2025	Sujet
ÉPREUVE E2 : Étude et préparation d'une production industrielle	Durée : 4 heures	Coefficient : 4	Page 18/18